

CONTENTS

Glukhova O. E., Meschanov V. P., Saliy I. N., Terentev O. A. <i>Irregular Carbon Nanotubes as Rectilinear Oriented Rods</i>	2
Potapov A. A. <i>Principles of Nanosystems Designing</i>	5
Panfilov Yu. V. <i>Practical Results of Use of Nano-Structured Materials</i>	13
Tyagunov O. A. <i>Programmed Complex for Simulation and Research of Dynamic Characteristics of Micro- and Nanomechanical Elements and Systems</i>	19
Khorunzhii I. A., Domanevsky D. S., Bobuchenko D. S. <i>Computer Verification of Computer Model of Heat Sink for Cooling of Powerful Semiconductor Device</i>	25
Belozubov E. M., Belozubova N. E. <i>Unsteady Temperature Influence on MEMS of the Thin-Film Resistive-Strain Pressure Sensors Ways of Its Minimization</i>	28
Afonin S. M. <i>Research and Calculation Static and Dynamic Characteristics of Piezoactuator for Nano- and Micrometric Movement</i>	34
Astahov M. V., Dutov I. V., Rodin A. O. <i>Ferromagnetic Resonance of Amorphous Ferromagnetic Microwire</i>	42
Kozlov G. V., Aphashagova Z. Kh., Burya A. I. <i>The Theoretical Description of Nanoadhesion Effect in Particulate-Filled Polymer Nanocomposites: the Fractal Model</i>	45
Komlenok M. S., Pimenov S. M., Kononenko V. V., Konov V. I., Scheibe H.-J. <i>Laser Surface Microstructuring of Super Hard Amorphous Carbon Films</i>	48
Aleksandrov P. A., Demakov K. D., Shemardov S. G., Kuznetsov Yu. Yu. <i>Crystalline Quality Improvement of Silicon on Sapphire Film by Oxygen Implantation and Subsequent Solid Phase Recrystallization</i>	54
Tarnavsky G. A., Anishchik V. S., Tarnavsky A. G. <i>Effect of Protective Masks at Tempering of Silicon Plate on Formation of Nano-Scale Heterostructures of Doping of Phosphorus</i>	57

For foreign subscribers:

Journal of "NANO and MICROSYSTEM TECHNIQUE" (Nano- i mikrosistemnaya tekhnika, ISSN 1813-8586)

The journal bought since november 1999.

Editor-in-Chief Ph. D. Petr P. Maltsev

ISSN 1813-8586.

Address is: 4, Stromynsky Lane, Moscow, 107076, Russia. Tel./Fax: +7(495) 269-5510.

E-mail: it@novtex.ru; <http://www.microsystems.ru>

Адрес редакции журнала: 107076, Москва, Стромынский пер., 4/1. Телефон редакции журнала (495) 269-5510. E-mail: it@novtex.ru
Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации ПИ № 77-18289 от 06.09.04.

Дизайнер *Т. Н. Погорелова*. Технический редактор *Е. М. Патрушева*. Корректор *Е. В. Комиссарова*

Сдано в набор 21.01.2008. Подписано в печать 19.02.2008. Формат 60×88 1/8. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 9,8. Уч.-изд. л. 11,40. Заказ 161. Цена договорная

Отпечатано в ООО "Подольская Периодика", 142110, Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, 15